

培養細胞への酸素供給

はじめに

液体培地で好気性微生物や動植物細胞を培養すると き,効率的な培養を実現するためには十分かつ適正な酸 素供給が行われなければならない.いうまでもなく,大 部分の生物にとって酸素は生命活動を営むために必須の ものである.生物は呼吸を行い,グルコースなどの糖類 や脂肪を酸化して得たエネルギーでATPを合成し,これ を利用して生命活動を行っている.呼吸を化学量論的に 考えれば下記の反応式より,180gのグルコースを完全 に酸化するには192gの酸素が必要であることがわかる.

 $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6H_2O + 6CO_2$

グルコースは水に易溶な物質で、水100 mL (25°C) に対して約90 gも溶けるが、酸素は難溶性のガスであ るためその溶解度はきわめて低く、大気下で通常の培地 (30°C) に溶ける酸素量は、せいぜい8×10⁻³ kg-O₂·m⁻³ (8 ppm) 程度である.これは、通常の微生物培養系に おいては、新たな酸素供給がなければ数分で消費されて しまう酸素量である.このため、培地への酸素供給は連 続的に行う必要がある.この講座では、液体培地で細胞 培養を行う際に知っておきたい酸素供給に関する基礎知 識を紹介する.

溶存酸素

ヘンリー (Henry) 定数*H*の単位に注意 一定量 の液体に溶けるガスの量には限度がある.この限度をガ スの溶解度という.難溶性ガスである酸素の培地への溶 解度を論ずるときは、Henry 定数*H*用いるのが一般的で ある.いま、気相中の酸素分圧を p_{02} 、気相の全圧をp, 酸素のモル分率を y_{02} とすると、酸素分圧 p_{02} と液相へ溶 解する飽和酸素濃度 C_{02} の間には式(1)のような比例関 係がある.ここで、*H*はHenry 定数で、その単位はたと えば [atm·m³·kg-O₂⁻¹] であり、ガスの溶け難さを表して いる.したがって、難溶性のガスほど大きな値をとる. *H*は温度の関数なので、その値は温度により変化する. もし、一定温度においてpあるいは p_{02} が高くなると、 C_{02} もまた高くなる.

$$p_{O_2} = py_{O_2} = HC_{O_2}^*$$
(1)
$$C_{O_2}^* = \frac{1}{H} p_{O_2}$$
(2)

黒澤

勎

International Critical Tables, vol. IIIを参照すると, 30°Cにおいて酸素の水に対するヘンリー定数は, $H = 26.1 \text{ atm} \cdot \text{m}^3 \cdot \text{kg-O}_2^{-1} となる^{-1}$. このHの逆数は酸素分圧 が1 atmのときにどれくらいの酸素が液中に溶けるか, すなわち酸素の溶解度 (kg-O₂·m⁻³·atm⁻¹)を表している. Hの逆数をH'と表すこともあるが, Hのままで用いて いる場合もあるので,使用にあたってはHの単位に注意 する必要がある. また, p_{O_2} はあくまでも酸素の圧力で あり,大気圧ではないことにも注意したい. 学生の計算 結果が5倍ほど違うときは,空気と酸素の区別が曖昧で, p_{O_2} の値を勘違いしている可能が大である.

酸素電極(溶存酸素計) 溶存酸素を測定する手段 としては酸素電極が広く利用されている. 電極内部には 2種類の金属(作用電極と対極)が配置され、電解液が 満たされている.電極先端は酸素を通過させるがイオン は通さないテフロン膜で覆われている(隔膜式電極). 膜を通過した酸素によって、電極内部では金属の酸化還 元反応が起こり、通過酸素量に相当する電流が流れる. 膜を通過する酸素の量は測定液中の溶存酸素濃度に比例 するので、電流値を測定すれば溶存酸素濃度を求めるこ とができる. 隔膜式電極には. 外部から一定電圧(0.5~0.8 V)をかけるポーラログラフ式と外部からの電圧を加え ないガルバニ電池式の二つの方式がある²⁾. 図1に隔膜 式電極の構造を示す。両電極の構造に大きな違いはない が、作用電極と対極に使用される金属の組合せや電解液 が異なる.

酸素電極は酸素を消費する 酸素電極を使用する際 に気をつけたいことは、以下の点である. ①電極は使用前に必ず校正する

5% 亜硫酸ナトリウム溶液を調製し,溶存酸素濃度が ゼロの状態をつくり,0点校正を行う.次に,純水に空 気を吹き込んで(通気して),大気のpo2で平衡化させ, 飽和点校正を行う.飽和溶存酸素濃度は温度によって異 なるので,この操作は一定温度下で行う.溶存酸素濃度 をパーセントで表示する酸素モニターでは,空気による

著者紹介 山梨大学 生命環境学部 生命工学科(教授) E-mail: kurohiro@yamanashi.ac.jp





図2. 二重境膜説に基づく酸素移動

飽和溶存酸素濃度を100%と表示する機種と21%と表示する機種があるので注意が必要である.

②電極が酸素を消費することに注意

隔膜式酸素電極は、その原理上酸素を消費する.液が 流動していない場合,隔膜近傍の酸素が消費されて,隔 膜内外の酸素移動平衡が保たれなくなるので正しい計測 ができなくなる.よって,電極先端(隔膜近傍)の液が 一定以上の流速で流れるように適切な撹拌を行う必要が ある.培養液の容量が小さい細胞培養系で,溶存酸素濃 度の減少から細胞の呼吸速度を求めようとする場合に は、十分な撹拌が実施されているかが重要なポイントに なる.細胞の呼吸速度を測定したつもりが,酸素電極の 酸素消費速度を測定していたということになっては大変 である.また,隔膜式酸素電極には、その原理上応答遅 れがあることにも注意したい.

③電極のメンテナンス

酸素電極を使用していると、隔膜が汚れたり電解液が 劣化したりして、出力が低下する. 良い測定を行うには、 使用する度に隔膜と電解液の交換をすることが望ましい ので、交換用の隔膜と電解液は常に準備しておきたい. ここで注意するのは電解液である.隔膜式酸素電極には、 前掲の二つのタイプがあって、使用する電解液が異なる 場合があるからである. 両極間に一定電圧をかけるポー ラログラフ式では、電解液が塩化カリウム (KCl) か水 酸化カリウム (KOH) が使われている. 一方、外から 電圧を加えなくてもそれ自体が電池となって電流が流れ るガルバニ電池式では、電解液はKOHが使われている. 研究室にあった古い酸素電極を使おうとして、電解液を 注文する場合は、どちらのタイプの酸素電極なのかをま ず確認したい. ガルバニ電池式の電極に、手元にあった pH測定用のガラス電極のKCl電解液を入れたために, 出力が得られなかったという事例もある.

酸素移動

酸素移動速度(Oxygen transfer rate; OTR)

空気中の酸素が培地などの液体に溶けて溶存酸素 (Dissolved oxygen; DO)になるには、気相の酸素分子 O₂が液相へ移動しなければならない、培養系への酸素 供給の手段は通気撹拌が一般的である、通気管から液中 に送り込まれたガスは、撹拌翼で分散されて微小な気泡 となって培養液中に一定時間漂う、この間に気泡中(気 相)の酸素が培養液中(液相)へ移動して溶存酸素とな る、この時の単位容積当たりの酸素移動速度 (Oxygen transfer rate; OTR [mol·m⁻³·s⁻¹])は、二重境膜説に基づ き式(3)のように表される。

 $OTR = k_L a \left(C^* - C \right) \qquad (3)$

 $k_La: 酸素移動容量係数 [s⁻¹]$

C*:気泡の酸素分圧と平衡な溶存酸素濃度 [mol·m⁻³]
 C:培養液中の溶存酸素濃度 [mol·m⁻³]

二重境膜説 気相から液相への酸素移動は、気 – 液 界面の両側に境膜を考え、その部分に移動抵抗があると する二重境膜説(two-film theory、定常モデル)(図2) によって説明されている³⁾. すなわち、気相側に厚さ δ_G の境膜を、液相側には厚さ δ_L の境膜を想定し、前提と して次の3条件を仮定すると気 – 液間の酸素移動がうま く説明できる.

1) 気 – 液界面の近傍には、その両側に乱れのない(流 れのない)薄い境膜(気境膜と液境膜)が存在し、酸素 は両境膜内を分子拡散のみで移動する.気 – 液界面の液 境膜にもっとも大きい移動抵抗があり,酸素移動速度の 律速段階となっている.

2) 両境膜内の酸素濃度分布は時間によらない(定常 状態が成立している).

3) 界面では、気相の酸素分圧と液相の酸素濃度との 間に常に平衡関係(Henryの法則)が成立している.

この定常モデルでは、境膜の外側では濃度が一定で、 濃度勾配は境膜内でのみ直線的に存在し、界面における 気相側の酸素分圧*P*_iと液相側の溶存酸素濃度*C*_iとの間 には相平衡が存在していることになる.

酸素移動流束(流束は流速ではない) 酸素分子の 拡散移動は相間に濃度勾配がある時に起こり,その移動 流束は濃度勾配に比例し,移動抵抗に逆比例する.ここ で,移動抵抗の逆数を拡散係数とすると,移動流束と濃 度勾配との関係は次のように表される.

(移動流束) = (拡散係数) × (濃度勾配)

余談ではあるが,講義で「流束」と板書すると,「流速」 の間違いではないかと学生に指摘を受けることがある. その都度,「流束」はフラックス(Flux)といって,単 位面積を単位時間に通過する量であることを再確認している.

ここで、液境膜における酸素移動流束を N_L とする. N_L は移動する方向に垂直な単位面積を単位時間に通過 する酸素量で、拡散係数 D_L と酸素濃度勾配 (dC_x/dx)の 積で表される.

$$N_L = -D_L \frac{dC_x}{dx} \qquad (4)$$

 N_L :液境膜酸素移動流束 $[mol \cdot m^{-2} \cdot s^{-1}]$ D_L :液境膜酸素拡散係数 $[m^2 \cdot s^{-1}]$ x:界面からの距離(境膜内での位置) [m] C_x :位置xにおける酸素濃度 $[mol \cdot m^{-3}]$

さて,式(4)を境界条件(x = 0において $C_x = C_i, x = \delta_L$ において $C_x = C$)のもとで積分すると,

$$N_L = \frac{D_L}{\delta_L} (C_i - C) \tag{5}$$

ここで,

$$k_L \equiv \frac{D_L}{\delta_L} \qquad (6)$$

とおくと、式(7)の関係が得られる.

$$N_L = K_L \left(C_i - C \right) \tag{7}$$

 k_L :液境膜物質移動係数 $[m \cdot s^{-1}]$ C_i :界面における液相側の溶存酸素濃度 $[mol \cdot m^{-3}]$

- C:液相の溶存酸素濃度 [mol·m⁻³]
- *δ*_L:液境膜の厚さ[m]

詳細は省くが,同様に気境膜における酸素移動流束 N_Gとすると,

$$N_{G} = \frac{D_{G}}{RT\delta_{G}} (P - P_{i}) = k_{G} (P - P_{i})$$
(8)
$$K_{G} \equiv \frac{D_{G}}{RT\delta_{G}}$$
(9)

 N_G : 気境膜酸素移動流束 [mol·m⁻²·s⁻¹]

- k_G : 気境膜物質移動係数 [mol·m⁻²·s⁻¹·atm⁻¹]
- *P_i*: 界面における気相側の酸素分圧 [atm]
- P : 気相の酸素分圧 [atm]
- D_G : 気境膜酸素拡散係数 [m²·s⁻¹]
- R: 気体定数 [m³·atm·mol⁻¹·K⁻¹]
- T : 絶対温度 [K]
- δ_G:気境膜の厚さ[m]

気体定数RはSI単位系では、8.314 Pa·m³·mol⁻¹·K⁻¹、または8.314 J·mol⁻¹·K⁻¹で表されるが、[m³·atm·mol⁻¹·K⁻¹]では $R = 8.205 \times 10^{-5}$ になるので、単位には注意したい.

ここで各相における気 – 液平衡をHenryの法則より関 連づけると、界面では、

$$P_i = HC_i \qquad (10)$$

気相本体の酸素分圧Pと平衡状態にある溶存酸素濃度を C^{*}とすると、気相では、

$$P = HC^* \qquad (11)$$

液相本体の溶存酸素濃度Cと平衡状態にある酸素分圧を P*とすると、液相では、

$$P^* = HC \qquad (12)$$

式 (10), (11) を式 (8) に代入すると,

$$N_G = Hk_G \left(C^* - C_i\right) \qquad (13)$$

ここで,液相濃度基準の全体の酸素移動流束Nを考えると,

$$N = k_L (C^* - C)$$
 (14)

KL:液相濃度基準の総括物質移動係数[m·s-1]

定常状態では $N = N_L = N_G$ であるから、式(7)、(13)、(14) より、

生物工学 第91卷

$$k_L(C^* - C) = k_L(C_i - C) = Hk_G(C^* - C)$$
(15)

加比の理により,

$$N = \frac{C_i - C}{\frac{1}{k_L}} = \frac{C^* - C_i}{\frac{1}{Hk_G}} = \frac{C^* - C}{\frac{1}{k_L} + \frac{1}{Hk_G}}$$
(16)

ここで k_G は通常 k_L に比べてかなり大きく,また,酸素 は水に溶けにくいためHはかなり大きい値となる.よっ て, $1/(H \cdot k_G)$ は $1/k_L$ に対して無視できるので,酸素移動 流束は式(17)となる.

$$N = k_L (C^* - C)$$
 (17)

酸素移動容量係数 ($k_L a \, \mathrm{d} \, k_L \, \mathrm{d} \, \mathrm{$

酸素移動を流束[mol·m⁻²·s⁻¹]で取り扱うには、酸素移 動の面積(気-液間の接触面積)が明確にされなければ ならない.しかし、培養槽に通気が行われているときの 気液接触面積A [m²]を知ることはきわめて困難である. そこで一般的には、酸素の移動速度は単位面積について ではなく、培養液の単位容積当たりの酸素移動速度 (OTR : [mol·m⁻³·s⁻¹])で表されている.いま、培養液の 体積をV [m³]としたとき、AをVで除せば、単位容積当 たりの気液接触面積a [m⁻¹]が求められる.

$$\frac{A}{V} = a$$
 (18)
a:単位容積当たりの気液接触面積 [m⁻¹]

式(17)の両辺に*a*を乗じると、単位容積当たりの酸素 移動速度となる。

$$OTR = N \cdot \frac{A}{V} = k_L \cdot a \left(C^* - C \right)$$
(19)

ここで、 k_L (液境膜物質移動係数: $[m \cdot s^{-1}]$) とaを一つ にまとめて $k_L a$ とすると、先の式(3) となる、 $k_L a$ は酸 素 移 動 容 量 係 数 (volumetric coefficient of mass transfer) と呼ばれ、その単位の次元は時間の逆数 T^{-1} で ある、 $k_L a$ は培養槽の酸素供給能力の指標となるため、 培養槽の設計や運転条件を設定する上で便利な数値をと して利用されている、 $k_L a$ は実験的に求めることが可能 である。

静的方法(static method)によるk_Laの測定 酸素 電極で液中の溶存酸素濃度の変化を測定し,記録紙に記 録された溶存酸素濃度の増加曲線を解析することによっ て, k_Laを求めることができる.培養槽に窒素ガスを吹 き込んで液中の酸素を置換し,酸素レベルを下げておく. この脱酸素した液に通気撹拌を行い,溶存酸素濃度の変 化を酸素電極で測定すると,図3のような溶存酸素濃度



の増加曲線が得られる. これを下記の式 (21) に従い 解析して*k_La*を求める方法を静的方法 (static method) という.

図3において,溶存酸素濃度曲線の接線の傾き(*dC/dt*) は酸素移動速度OTRを表す.よって,式(3)より,式 (20)が得られる.

$$\frac{dC}{dt} = k_L a \left(C^* - C \right) \tag{20}$$

 C^* : 飽和溶存酸素濃度 [mol·m⁻³]

C:溶存酸素濃度(測定值)[mol·m⁻³]

 $k_La: 酸素移動容量係数 [s⁻¹]$

t :時間 [s]

式 (20) を初期条件
$$t = 0, C = C_0$$
 のもとで積分すると,

$$ln\frac{(C^*-C)}{(C^*-C_0)} = -k_L a \cdot t \qquad (21)$$

従って、片対数グラフ用紙の対数軸に ($C^{*} - C$) / ($C^{*} - C_{0}$) を、普通軸に時間 t [s] をプロットすれば図4のような 直線関係が得られる. この直線の勾配は – k_{La} となる.

酸素供給速度を高める方法 式(20)によると, 酸素供給速度を高めるには、 k_La を大きくするか、酸素 濃度勾配(C^*-C)を大きくすればよいことがわかる.し たがって、気液接触面積をふやせば、 k_La は大きくなる. っまり、通気量は同じでも、気泡を小さく分散すれば、 k_La を大きくできる、撹拌には気泡を微細化する効果が あるので、撹拌速度を高くすることは k_La を高めるのに 効果的である、濃度勾配(C^*-C)を大きくするには、た とえば、空気を通気する代わりに純酸素ガスを通気して C^* を大きくする方法がある、これによって、(C^*-C)を 大きくとれるようになり、酸素供給速度を高く保つこと ができる。しかし、溶存酸素濃度Cが C^* に近づくにつ れて、濃度勾配は小さくなっていき、 $C = C^*$ となった時

2013年 第11号



図4. k,aを求めるための片対数プロット

に $C^* - C = 0$ となるので,見かけ上酸素供給速度は0と なる.注意したいのは,撹拌速度を高くしても C^* は変 わらないということである. C^* は通気ガスの酸素分圧 に依存し,撹拌速度には依存しない.

酸素供給と酸素消費

通気撹拌培養における酸素供給と酸素消費 微生物 の培養中に通気を一時的に停止すると、菌の呼吸により 酸素が消費され直線的なCの減少(直線イロ)が起こる (図5).この直線イロの傾斜からは、菌の呼吸速度 (r_{02} = Q_{02} ·X)を求めることができまる.ロにおいて通気を 再開すると、Cは漸次増加して平衡に達する.ロハ間に おけるCの増加曲線の接線は酸素移動速度 (dC/dt)であ り,式 (23)に示されるように培養液への酸素供給速度 と菌の呼吸速度の差となる.

$$r_{\mathrm{O}_2} = Q_{\mathrm{O}_2} \cdot X \qquad (22)$$

ro₂ : 呼吸速度 [mol·m⁻³·s⁻¹]

- *Q*o₂:比呼吸速度 [mol·kg-cell⁻¹·s⁻¹]
- X : 菌体濃度 [kg-cell·m⁻³]

$$\frac{dC}{dt} = k_L a \left(C^* - C \right) - Q_{O_2} \cdot X \tag{23}$$

図5のハの領域ではCの変化は緩やかであり, dC/dt = 0 の定常状態近似が成立するので,式(24)のように左辺 の酸素供給と右辺の酸素消費がバランスした状態となる.

$$k_L a (C^* - C) = Q_{O_2} \cdot X$$
 (24)

ある培養条件において、左辺の $C^* \ge k_L$ は定数で与えられるので、酸素供給速度はCの値に依存する、理論上の最大酸素供給速度はC = 0のときである、右辺の Qo_2 は、



図5. 培養系における酸素濃度変化曲線

培養菌体(細胞)の種類によって決まる定数であるので, 所定の培養条件において培養可能な最大菌体濃度を酸素 需給の観点から式(25)によって推定することが可能 である.

$$X = \frac{k_L a \cdot C^*}{Q_{O_2}} \qquad (25)$$

細胞集塊や固定化細胞への酸素供給 糸状菌のペ レットや球状のゲルマトリックス(ゲルビーズ)に包括 固定した好気性微生物、および肝細胞スフェロイドなど の細胞集塊への酸素供給では、密集した細胞や固定化担 体が物質移動の障害となり、酸素供給不足が生じやすく なる.たとえば、球状細胞塊では、その内部への酸素移 動の推進力は分子拡散のみとなるので、酸素は球状塊の 周辺部に存在する細胞に消費し尽くされてしまい. 中心 部分まで到達することができない場合が生じうる.この 結果,中心部に存在する細胞への酸素供給不足が生じ, この状態が続くと中心部の細胞は死滅してしまう.よっ て、細胞集塊への酸素供給は、酸素の拡散移動速度と細 胞の呼吸速度を考慮して、中心部に存在する細胞が酸素 不足に陥らないような酸素供給条件を設定する必要があ る。あるいは、酸素供給不足とならないように細胞集塊 のサイズを制御する必要がある.

細胞集塊内部へ酸素が到達するか否かは、細胞の呼吸 速度、酸素の拡散係数、細胞密度などの基本情報が得ら れれば、以下のような条件のもとで定常状態を仮定する ことによって推算できる^{4,5)}.

- 1) 細胞集塊は球形である.
- 2) 細胞は均一に分布している.
- 3)酸素が唯一の律速する因子である.

4)細胞の酸素消費に関して一次反応の動力学が適用

できる.

5)酸素の拡散性は集塊内で一定,拡散速度はFickの 法則に従う.

よって、酸素の拡散流束 N_a [mol·m⁻²·s⁻¹] は式(26) で この両辺を $4\pi r^2 dr$ で割り、 $dr \rightarrow 0$ 極限を考えると、 表される.

$$N_A = D_{Ae} \frac{dC_A}{dr} \qquad (26)$$

 N_A :酸素の拡散流束 [mol·m⁻²·s⁻¹]

 D_{Ae} : 有効拡散係数 [m²·s⁻¹]

 C_{A} : 細胞集塊内の溶存酸素濃度 [mol·m⁻³]

ここで、図6に示すような、半径Rの球状細胞集塊を 考える. そして、バルク培地中の溶存酸素濃度、すなわ ち細胞集塊表面における溶存酸素濃度をC_{AS}として,酸 素が細胞集塊内部に拡散移動していく状況を想定する. さらに, 任意の半径rおよび (r + dr) の球面で囲まれた 球殻(微小空間)を設定し、この部分でおこる呼吸によ る酸素消費を伴う酸素拡散移動の物質収支をとる.

(流入) - (流出) + (生成) - (消費) = (蓄積)

ここで、細胞集塊内部での酸素の生成と蓄積はゼロと考 えられるので.

(流入) - (流出) - (消費) = 0

流束の式(26)と呼吸に関する式(22)より、

$$(4\pi r^2 N_A)_{r+dt} - (4\pi r^2 N_A)_r - 4\pi r^2 dr (r_{\rm O2}) = 0$$



図6. 球状細胞集塊の球殻における物質収支と酸素濃度分布

$$4\pi D_{Ae}\left\{\left(r^{2}\frac{dC_{A}}{dr}\right)_{r+dr}-\left(r^{2}\frac{dC_{A}}{dr}\right)_{r}\right\}-4\pi r^{2}dr\left(r_{O_{2}}\right)=0$$
(27)

$$\frac{1}{r^2} D_{Ae} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dC_A}{dr} \right) - r_{O_2} = 0$$
$$D_{Ae} \left(\frac{d^2 C_A}{dr^2} + \frac{2}{r} \frac{dC_A}{dr} \right) - r_{O_2} = 0$$
(28)

さらに、酸素消費反応を一次反応であると仮定すると、 呼吸速度r₀,は式(29)のように表すことができる.

$$r_{\rm O_2} = kC_A \qquad (29)$$

k: 一次の反応速度定数 [s⁻¹]

酸素消費反応にはミカエリス・メンテン型の動力学を適 用するのが最善であるが、ここでは単純化のために一次 反応を適用する.したがって、式(28)に式(29)を 代入して式(30)を得る.

$$D_{Ae}\left(\frac{d^2C_A}{dr^2} + \frac{2}{r}\frac{dC_A}{dr}\right) - kC_A = 0$$
$$\frac{d^2C_A}{dr_2} + \frac{2}{r}\frac{dC_A}{dr} - \frac{k}{D_{Ae}}C_A = 0 \qquad (30)$$

さらに下記の境界条件のもとで積分すると、 細胞集塊表面:r = R, $C_A = C_{AS}$ 細胞集塊中心:r=0, $dC_A/dr=0$

$$C_{A} = C_{AS} \frac{R}{r} \frac{\sinh\left(r\sqrt{k/D_{Ae}}\right)}{\sinh\left(R\sqrt{k/D_{Ae}}\right)}$$
(31)

ここに、式 (32) で定義されるシーレモジュラス (Thiele 速度の比)を導入する.

$$\phi = R\sqrt{k / D_{Ae}}$$
(32)
$$\frac{C_A}{C_{AS}} = \frac{R}{r} \frac{\sinh(\phi \cdot r / R)}{\sinh\phi}$$
(33)

ここで.

$$C_A^* = \frac{C_A}{C_{AS}}$$
$$r^* = \frac{r}{R}$$

として, 溶存酸素濃度と半径を相対値で表し無次元化す ると、細胞集塊内の酸素濃度分布を与える式(34)が えられる.



$$C_A^* = \frac{\sinh(\phi \cdot r^*)}{r^* \sinh\phi} \qquad (34)$$

式 (34) において, *sinh*はハイパボリック・サイン (hyperbolic sine)を示し, *sinh*¢は次のように定義される.

$$\sinh\phi = \frac{e^{\phi} - e^{-\phi}}{2} \tag{35}$$

式 (34), (35) を利用すれば,表計算ソフトでも酸素 濃度分布を計算することができる.図7に計算結果の例 を示した. r^* を0.01~1.0の間で変化させ,そのときの $C_A^* \epsilon \phi = 1, 3, 5, 10$ のときについて計算した.図7より, ϕ が大きくなるほど細胞集塊の中心部分が酸素不足にな りやすいことがわかる. $\phi = 1$ では中心部でも表面の80% 以上の酸素濃度が維持されているが, $\phi = 5$ ではそれが 10%以下に低下する. $\phi = 10$ では細胞集塊の大部分が酸 素不足に陥る.式 (32)の ϕ の定義より,細胞集塊の半 径Rが大きくなるほど,また酸素消費速度が高くなるほ ど,細胞集塊内は酸素不足になりやすいことが分かる. 酸素不足に陥らないようにするには、細胞集塊のサイズ をできるだけ小さく保ち,酸素の拡散速度を高くする工 夫が必要である.

また、 ϕ は細胞集塊の酸素充足度を推定する際にも有 効である. 触媒有効係数 η (0 $\leq \eta \leq 1$)は、固定化触媒 が有効に機能しているかの指標であるが、 η を見かけの 呼吸速度 (r_{O_2} , obs)と細胞集塊内の溶存酸素濃度が一様に C_{AS} であるとしたときの呼吸速度 (r_{O_2} , css)の比として式 (36)で定義すれば、球状細胞集塊内で酸素が到達して いる部分の割合を知ることができ、酸素充足度の指標と しても利用できる. たとえば、 $\phi = 10$ では $\eta = 0.27$ となり、 細胞集塊の7割以上が酸素不足になっていることが推定 できる.

表1.	各種培養皿	の培養面積	と	標準培地	且量
-----	-------	-------	---	------	----

種類	培養面積 (概算值)	標準培地量	液深
	$A [cm^2]$	V[mL]	<i>h</i> [mm]
90 mm dish	60	12	2
60 mm dish	20	4	2
6 well multi-	10	2	2
12 well multi-	4	0.8	2
24 well multi-	2	0.4	2

$$\eta = \frac{r_{0_{2}, \text{ obs}}}{r_{0_{2}, C_{AS}}} = \frac{D_{Ae} \left(\frac{dC_{A}}{dr}\right)_{r=R} \cdot 4\pi R^{2}}{kC_{AS} \cdot \frac{4}{3}\pi R^{3}}$$
(36)

よって,式 (31) をrで微分し,式 (36) に代入すると 式 (37) のように, ηをφの関数で表すことができる.

$$\eta = \frac{3}{\phi^2} (\phi \coth \phi - 1) \qquad (37)$$
$$\cosh \phi = \frac{e^{\phi} + e^{-\phi}}{e^{\phi} - e^{-\phi}} \qquad (38)$$

ここで注意することは、 ¢の定義である. ¢は式 (39) のように定義されることも多く、その場合、式 (34) の形が異なってくる. また、式 (26) や(29) では、負 の符号をつけることもある. これは、観測者の視点から 現象を正負どちらの方向で捉えるかによるので、どちら も可である.

$$\phi = \frac{R}{3} \sqrt{\frac{k}{D_{Ae}}} \tag{39}$$

培養皿における動物細胞の静置培養 動物細胞や組 織の培養では,通気撹拌が行われることは希で,培養皿 に接着させて静置培養するのが一般的である.静置培養 では,酸素供給は気 – 液界面(その面積は培養皿の面積 に等しい)からの酸素移動によってのみまかなわれる. 培養皿のk_Laは,式(40)の関係より,培地の液深(h;[m]) が大きくなるほど低下する.

$$k_L a = k_L \cdot \frac{A}{V} = \frac{k_L}{h} \tag{40}$$

標準的な培養では,表1に示されるように,液深は2 mmで行われている.不用意に培地を多く入れて液深を 増大させると,酸素不足が生じる可能性があるので注意 が必要である.理論的には液深を浅くすれば酸素供給は 高まるが,培地からの栄養供給や培養環境を安定的に維 持するには不利になる.細胞の高密度培養が必要なとき は,通常よりも酸素分圧を高めたガスをインキュベータ へ供給するなどの対策が必要である.

おわりに

多くの細胞培養系において、酸素は培養の成否にかか わるきわめて重要な因子である.しかし、培養温度や培 地成分に比べると、酸素供給にはあまり注意が払われて いないように思える.生物化学工学や培養工学の素養が ないと、溶存酸素や酸素移動を十分に理解することは難 しく、酸素が律速因子となって培養に問題が生じている ことに気づかないことがある.たとえば、図7に示した ように、細胞集塊が大きくなると、培地中の溶存酸素濃 度は十分でもその内部では酸素不足に陥ることがある. 培養が上手くいかないときは、「酸素は足りているだろ うか」と自問することをお奨めする.また、ときには生 物化学工学の教科書を紐解いてみてほしい. そこには, 現在の課題を解決するヒント(考え方)が記されていた りする.時代により研究テーマに流行り廃りはあるが, 生物化学工学の考え方は,いつの時代にも通用すると思 うし,いつも時代も細胞培養には酸素供給が必要である.

文 献

- 1) Doran, P. M.: *Bioprocess Engineering Principles*, Academic Press, p. 207 (1995).
- 2) 相澤睦夫: MS TODAY 2月号, p. 14 (2001).
- 3) 山根恒夫: 生物反応工学(第2版), p. 226 (1991).
- 4) Lee, J. M.: *Biochemical Engineering*, p. 60, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey (1991).
- 5) Doran, P. M.: *Bioprocess Engineering Principles*, Academic Press, p. 300 (1995).